

# 第 151 回ラドテック研究会講演会

期 日：2017年4月27日（木）13：00～16：40

場 所：東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階／記念講堂

主 催：一般社団法人ラドテック研究会

協 賛：一般社団法人近畿化学協会・一般社団法人色材協会

一般社団法人日本接着学会・日本塗装技術協会・日本放射線化学会

一般社団法人有機エレクトロニクス材料研究会・フォトポリマー懇話会

合成樹脂工業協会（予定・順不同）

## <講師と演題>

### 1) 13：00～13：50

「樹脂界面の接着と残留応力」

神戸大学大学院 西野 孝 氏

樹脂を硬化させると収縮し、そこに接着が介在すると被着体との界面に応力が残留する。コーティング、ラミネート、接着、素子封止などにおいて残留応力は製品信頼性を妨げる大きな要因となっている。本講演では、残留応力の非破壊検出と低減化の事例を具体的に紹介する。

### 2) 13：50～14：40

「光重合を用いた多成分系ポリマーブレンドの相分離制御：現状と展望」

京都工芸繊維大学 宮田 貴章 氏

重合を含む反応性のポリマーブレンドは材料科学の様々な分野において広く利用されている。特定の条件下で実験を行う場合、反応性ポリマーブレンドは相反する相互作用の競合効果を示す典型的系であり、様々なモルフォロジーが発現する。ここで、この競合過程における二成分や三成分系ポリマーブレンドの相分離で形成された特異的なモルフォロジーとその利用について紹介する。

14：40 ～ 15：00 ♪♪♪♪♪ コーヒーブレイク ♪♪♪♪♪

### 3) 15：00～15：50

「NIR（近赤外光）に感光する開始剤とこれを用いたフォトポリマーへの応用」

サンアプロ株式会社 白石 篤志 氏

近年フォトポリマーに用いられる材料の多様化に伴い、要求される波長も極端紫外光領域から可視光領域へと多様化してきている。我々は、さらに長い近赤外光領域（NIR）に着目した。今回このNIR（近赤外光）に感光する開始剤とフォトポリマーへの応用について紹介する。

### 4) 15：50～16：40

「日本のUV/EB技術と市場の概観」

J S R株式会社 小宮 全 氏

ラドテック研究会では2016年10月に開催されたRadtech Asia 2016を機会に、ラドテック研究会メンバーに対してアンケートを募り、日本のUV/EB技術と市場動向について調査を行いました。その結果をご紹介します。

◆17：00～18：30 交流会・ミニ展示会 大会議室にて

1. 参加費  
個人会員（本人）無料  
法人会員（2名まで）無料 3名から1名10,000円  
非会員は1名20,000円  
協賛団体に所属されている方は下記の通りとなります。  
  
協賛団体所属の方：10,000円  
注・上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。
2. 申込締切日 2017年3月23日（木）
3. 申込方法 添付申込書に必要事項をご記入後E-mailにてお申し込み下さい。
4. 入金方法 参加費は銀行振込にてお願い致します。  
（尚、振込手数料はご負担下さい。）  
振込先： みずほ銀行 麴町支店（銀行コード：0001 店番号：  
021）  
口座番号： 普通預金）1361387  
口座名義： 一般社団法人ラドテック研究会  
名義カナ： シャ）ラドテックケンキュウカイ  
ご入金は開催日までにお問い合わせ下さい。  
※一度ご入金された参加費は返金致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
5. 参加証 ご入金確認後参加者本人宛お送り致します。  
従ってお申し込み及びご送金が申込締切日以降で開催日が迫っている場合は参加証が届かない場合がありますので、参加受付番号等を事務局まで事前にお問い合わせ下さい。なお、領収書は振込受領書をもってかえさせていただきます。
6. 問合せ先 一般社団法人ラドテック研究会事務局  
〒102-0082 千代田区一番町23-2 番町ロイヤルコート207  
TEL：03-6261-2750 FAX：03-6261-2751  
E-mail：[staff@radtechjapan.org](mailto:staff@radtechjapan.org)